

解糖系代謝産物の動態からみたイネ紋枯病抵抗性メカニズムに関する研究

井田純司\*・野瀬昭博・東江栄・和佐野喜久夫（佐賀大農）

本研究では解糖系の罹病に伴なう代謝産物の変動を分光法で調査した。材料には本研究室で選抜育成した抵抗性系統（強系統）および感受性系統（弱系統）の葉身部と葉鞘部を用いた。葉鞘部でグルコース 6 リン酸が弱系統で接種後 2 日目，強系統では 4 日目まで増加した。3 ホスホグリセリン酸は両系統で接種 2 日目まで増加し，その後減少した。葉身部では両代謝物ともに接種後 2 日目まで増加し，その後減少した。ホスホエノールピルビン酸は弱系統で 12 時間後に減少した。本研究の結果は GC/MS で得られた結果と類似した。